

上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 40

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 40
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:KDC 40 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

KRI 考夫曼离子源 KDC 40上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼 离子源 KDC 40:
小型低成本直流栅极离子源. KDC 40 是 3cm 考夫曼型离子源升级款. 具有更大的栅极, 更坚固,
可以配置自对准第三层栅极. 离子源 KDC 40 适用于所有的离子工艺, 例如预清洗, 表面改性, 辅助镀膜,
溅射镀膜, 离子蚀刻和沉积. 离子源 KDC 40 兼容惰性或活性气体, 例如氧气和氮气.
标准配置下离子能量范围 100 至 1200eV, 离子电流可以超过 120 mA.KRI 考夫曼 离子源 KDC
40 技术参数

型号	KDC 40
供电	DC magnetic confinement
- 阴极灯丝	1
- 阳极电压	0-100V DC
电子束	OptiBeam
- 栅极	专用, 自对准
- 栅极直径	4 cm
中和器	灯丝
电源控制	KSC 1202
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament 或 LFN 1000
- 架构	移动或快速法兰
- 高度	6.75'
- 直径	3.5'
- 离子束	集中平行散设
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	惰性活性混合
- 安装距离	6-18 "

- 自动控制

控制4种气体

* 可选: 可调角度的支架

KRI 考夫曼 [离子源](#) KDC 40 应用领域溅镀和蒸发镀膜 PC辅助镀膜(光学镀膜)IBAD表面改性, 激活 SM离子溅射沉积和多层结构 IBSD离子蚀刻 IBE

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士